

Title (en)  
BROADSIDE MOULD PLATE, CONTINUOUS CASTING MOULD AND METHOD FOR PRODUCING A BROADSIDE MOULD PLATE

Title (de)  
BREITSEITENKOKILLENPLATTE, STRANGGIESSKOKILLE UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER BREITSEITENKOKILLENPLATTE

Title (fr)  
PLAQUE DE LINGOTIÈRE À LARGE FACE, LINGOTIÈRE DE COULÉE CONTINUE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE PLAQUE DE LINGOTIÈRE À LARGE FACE

Publication  
**EP 4215296 A1 20230726 (DE)**

Application  
**EP 22209681 A 20221125**

Priority  
DE 102021215030 A 20211223

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft eine Breitseitenkokillenplatte (1) für eine Stranggießkokille, aufweisend eine Kontaktfläche (2) zum Kontaktieren eines in der Stranggießkokille gegossenen Gießstrangs, wobei in der Kontaktfläche (2) eine Vertiefung (3) ausgebildet ist, die bezüglich einer Breitenrichtung der Kontaktfläche (2) in einem mittleren Bereich der Kontaktfläche (2) angeordnet ist und eine Tiefe (T) aufweist, die sich in Richtung eines kokilleneintrittsseitigen oberen Randes (4) der Kontaktfläche (2) kontinuierlich vergrößert, wobei die Vertiefung (3) in Breitenrichtung der Kontaktfläche (2) beidseitig vorzugsweise jeweils stetig differenzierbar in einen eben ausgebildeten Flächenabschnitt (5, 6) der Kontaktfläche (2) übergeht, wobei die Flächenabschnitte (5, 6) in einer gemeinsamen Ebene angeordnet sind. Um innerhalb der Stranggießkokille mechanische Spannungen in der Strangschale des Gießstrangs zu minimieren, weist die Vertiefung (3) über ihre Höhe (L) eine konstante Breite (B) auf, ist zwischen dem unteren Ende der Vertiefung (3) und dem kokillenaustrittsseitigen unteren Rand (7) der Kontaktfläche (2) ein weiterer ebener Flächenabschnitt (8) der Kontaktfläche (2) angeordnet, der in der gemeinsamen Ebene liegt, und geht die Vertiefung (3) in Höhenrichtung z der Kontaktfläche (2) in einem zumindest stetigen unteren Übergang in den weiteren unteren Flächenabschnitt (8) über.

IPC 8 full level  
**B22D 11/04** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**B22D 11/0406** (2013.01); **B22D 11/0408** (2013.01)

Citation (applicant)  

- CN 101412080 A 20090422 - UNIV YANSHAN [CN]
- DE 3907351 A1 19900913 - SCHLOEMANN SIEMAG AG [DE]
- EP 0149734 A2 19850731 - SCHLOEMANN SIEMAG AG [DE]
- EP 0909597 A1 19990421 - DANIELI OFF MECC [IT]
- EP 1002599 A1 20000524 - SMS DEMAG AG [DE], et al

Citation (search report)  

- [X1] DE 20102524 U1 20010712 - EVERTZ EGON KG GMBH & CO [DE]
- [X1] US 6926067 B1 20050809 - HORNSCHEMEYER WOLFGANG [DE], et al
- [X1] US 2010000704 A1 20100107 - STREUBEL HANS [DE], et al
- [X1] KR 20040059083 A 20040705 - POSCO

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA

Designated validation state (EPC)  
KH MA MD TN

DOCDB simple family (publication)  
**EP 4215296 A1 20230726**; DE 102021215030 A1 20230629

DOCDB simple family (application)  
**EP 22209681 A 20221125**; DE 102021215030 A 20211223